2P039

陰イオン部位を持つドナー [EDO-TTF-(CH₃)PO₃H]⁻の合成

(京大低物セ¹,京大院・理²) O上中 敬太^{1,2},石川 学¹,中野 義明¹,矢持 秀起¹

Synthesis of a donor with an anion moiety, $[EDO-TTF-(CH_3)PO_3H]^-$

(LTM, Kyoto Univ.¹, Grad. Sch. Sci. Kyoto Univ.²)

OKeita Uenaka^{1, 2}, Manabu Ishikawa¹, Yoshiaki Nakano¹, Hideki Yamochi¹

本研究は、電荷移動錯体中に複数種のドナー分子を共存させ ることにより、電子状態の自由度を増大させ、外部の刺激によ って異種ドナー分子間での電荷の再分配が起きる等の新規な機 構に基づく電子相転移を発現させることを目指している。一般 に、複数種のドナー分子を含む錯体は結晶構造に乱れを含むが [1]、本研究では乱れを避け、周期構造に基づく新規な物性を 発現させるため、Figure 1 に示したように、錯体中の対イオ ンの位置に第 2 のドナー分子が規則的に取り込まれること を期待し、陰イオン部位を持つドナー分子の合成を計画した。



Figure 1. 標的とする錯体 の結晶構造と、電荷の再分 配の例。

陰イオン部位の候補として、pKa の小さな Brønsted 酸残基に着目した。Brønsted 酸残基は その種類によっては、電解条件下脱離することが報告されている [2]。そこで、本研究では外 場への敏感な応答を示す EDO-TTF (3) 骨格に、電解条件に耐えることが報告されているホス ホン酸残基と TTF 部分の化学的安定性を保つためのメチル基を導入した、

[PhNH₃]⁺[EDO-TTF-(CH₃)PO₃H]⁻(8) を検討することとした [3,4]。

本発表では、Scheme 1 に示した 1 を出発原料とした 8 の合成を報告する。この経路での 反応生成物の内、6 に対して脱トリメチルシリル反応を行った生成物の元素分析の結果を Table 1 にまとめた。Figure 2a にこの生成物と 8 の IR スペクトルを示した。



Scheme 1. 目的化合物 8 の合成経路。

8 のスペクトルは DFT 計算か らの予想とよく一致していたが、 6 からの反応生成物は 7 に対す る計算結果とは大きく異なった スペクトルを与えた。6 からの反 応生成物のスペクトルの内、C=C 伸縮振動の領域に着目すると各

Table 1.6 からの脱トリメチルシリル反応の生成物 の元素分析値 (%)。

	С	Н	S	Р	
Calc.	30.42	2.27	36.10	8.72	
Obs. 1	30.43	2.47	35.81	8.39	
Obs. 2	30.40	2.55	35.80	8.39	

実測ピークの位置は TTF 骨格が +1 価と 0 価の場合の中間に位置していた。さらに、4000 cm^{-1} に幅広の吸収帯が観測されたことから、この生成物中では TTF 部位が部分酸化状態に なっていると予測された (Figure 2b)。



Figure 2. (a) 6 からの反応生成物と 8 の IR スペクトル、及び、(b) 6 からの反応生成物の IR-NIR スペクトル (実測は KBr 法、計算は B3LYP/6-31G(d,p) による)。

この部分酸化状態は、9 についての報告において、 9 に対する同様の脱保護基反応で 10 と 10'の混 合物が得られたと推定されていることから、今回 の 6 からの反応でも双性イオン 7 と中性種 7'

の混合物が得られ、部分酸化状態が実現されたと 考えられる (Scheme 2) [3]。この 7 と 7' を含む 混合物と推定される黒色粉末とアニリンの反応



Scheme 2. 化合物 9 の脱保護反応。

生成物を、¹H NMR の結果から 8 であると推定した (¹H-NMR (600 MHz, DMSO-d₆)δ from TMS 2.23 (d, *J* = 2.4 Hz 3H), 4.30 (s, 4H), 6.49-6.57 (m, 3H), 7.00-7.02 (m, 2H) アミノ基とホスホン酸基由来の H は、[3] に示された類似化合物と同様に確認できなかった)。当日は、8 以外のアンモニウム塩の合成についても報告する。

【参考文献】

[1] C. S. Jacobsen *et al.*, *Phys. Rev. B.*, **18**, 905-921 (1978).
[2] M. Fourmigue *et al.*, *Chem. Rev.*, **104**, 5379-5418 (2004).
[3] A. Dolbecq *et al.*, *Chem. Eur. J.*, **2**, 1275-1282 (1996).
[4] M. Chollet *et al.*, *Science*, **307**, 86-89 (2005)